

TK-1

合成反応装置ケミストプラザ 高精度液温コントロール

合成反応において、温度を安定させることは、最も重要な条件のひとつです。温度コントロールを行っていても、オーバーシュートが原因で、貴重なサンプルを無駄にしてしまったこと、ございませんか？

弊社では、合成反応装置ケミストプラザCP-300型をベースに、従来の液温コントロールに加え、温度センサー2本と内温制御ユニットを追加するだけで

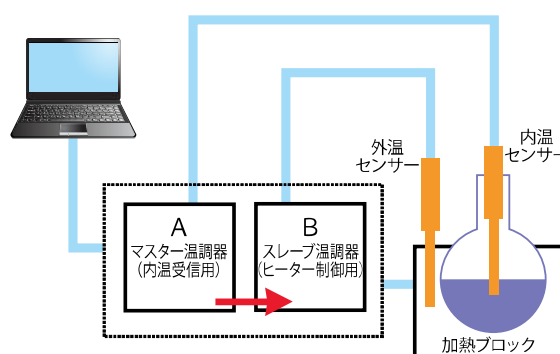
“オーバーシュートを抑制した新しいコントロール”での装置を、特注製作しております。

内容

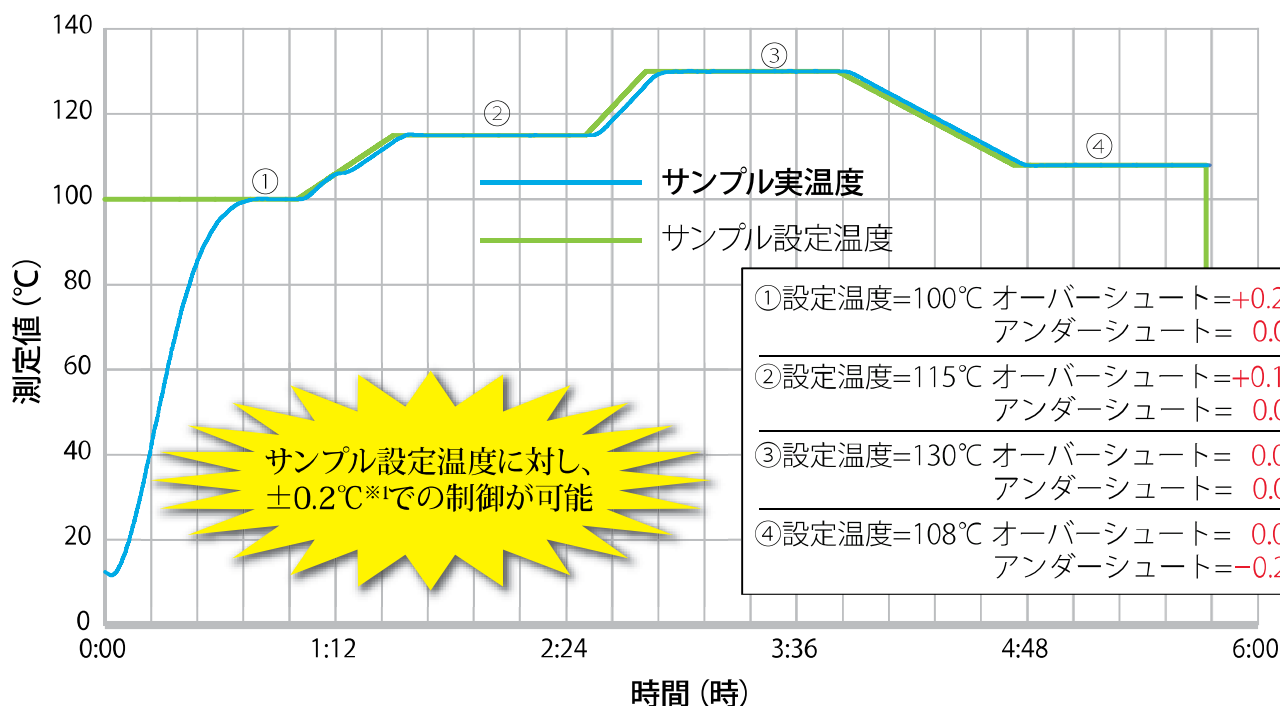
■ケミストプラザ ～ 高精度液温コントロール仕様 ～

- 構成：・合成反応装置 CP-300 型
- ・液温制御コントロールユニット
 - ・データ収集用パソコン ・セパラブル反応容器
 - ・低温循環水槽：C-580 型（設定温度-15℃）
- 仕様：・設定温度範囲 -20～+200℃（加熱・冷却仕様）
室温+10～300℃（加熱仕様）
- ・サンプル量 120～1000mL
 - ・簡易プログラム機能（液温コントロール）
 - ・スターラー攪拌（上部攪拌対応可）

■システム構成図



CP-300内温制御 プログラム運転



※1 サンプルによっては変動する場合があります。

作成：2018年3月
最終更新：2018年4月

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
http://www.sibata.co.jp/
発行：営業部マーケティング課